

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

第四十三届会议

2020年3月23日至26日，日内瓦

印度尼西亚共和国常驻联合国、世界贸易组织和日内瓦其他国际组织代表团
致世界知识产权组织大会以及商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会主席的
普通照会

秘书处编拟的文件

本文件附件中载有印度尼西亚共和国常驻联合国、世界贸易组织和日内瓦其他国际组织代表团致世界知识产权组织（产权组织）大会以及商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（SCT）主席的普通照会。照会中提出，如果产权组织大会决定召开通过外观设计法条约（DLT）外交会议，印度尼西亚愿意承办该会议。

[后接附件]

第 106/POL-I/XII/2019 号

印度尼西亚共和国常驻联合国、世界贸易组织和日内瓦其他国际组织代表团向世界知识产权组织（产权组织）谨致敬意，并荣幸地提及文件 A/59/13 ADD.5 中所反应的产权组织第五十九届成员国大会关于召开通过外观设计法条约（DLT）外交会议的事项的决定。

在产权组织框架内包括发展 DLT 在内的全球知识产权制度发展过程中，印度尼西亚一直并将继续是一个建设性伙伴。印度尼西亚致力于为推动关于 DLT 的讨论进一步作出贡献，以期就召开外交会议达成一致。

就此，印度尼西亚共和国常驻代表团再次荣幸地重申印度尼西亚对承办外观设计法条约外交会议的承诺和意愿，正如其在 2019 年 9 月 30 日产权组织第五十九届成员国大会的发言中所述。

印尼已通过众多国际活动展示了其承办资质，这些活动包括：2013 年 APEC 峰会、2013 年世界贸易组织部长级会议、2018 年亚运会、2018 年“我们的海洋”大会、2018 年国际货币基金组织和世界银行集团年会，以及即将召开的世界经济论坛东亚峰会、东盟峰会和二十国集团（G20）峰会。

印度尼西亚共和国常驻联合国、世界贸易组织和日内瓦其他国际组织代表团借此机会，再次向世界知识产权组织致以最崇高的敬意。

2019 年 12 月 10 日，日内瓦

（签字）

（盖章）

世界知识产权组织（产权组织）

Chemin des Colombettes 34

Geneva, Switzerland（瑞士）

抄送：

1. 产权组织大会
2. 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

[附件和文件完]